

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年1月2日(02.01.2025)



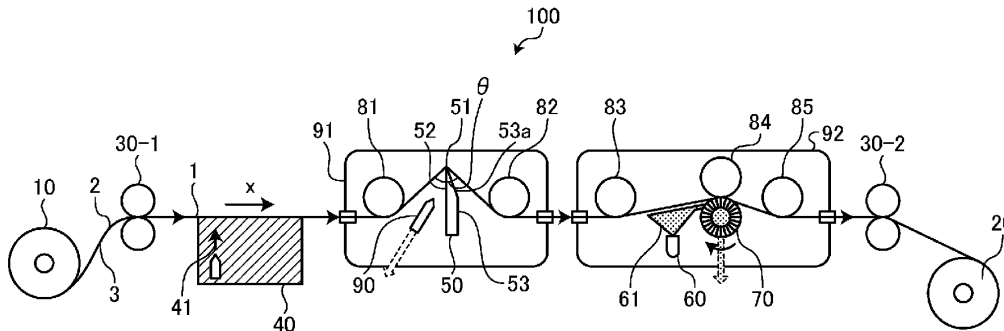
(10) 国際公開番号

WO 2025/004534 A1

- (51) 国際特許分類:
B08B 3/02 (2006.01) *B32B 27/00* (2006.01)
B08B 5/04 (2006.01) *C08J 11/06* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/016975
- (22) 国際出願日: 2024年5月7日(07.05.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-105037 2023年6月27日(27.06.2023) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 東田 佳久 (HIGASHIDA, Yoshihisa); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 谷野 聖 (TANINO, Kiyoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 渡邊 一敬 (WATANABE, Kazutaka); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所 (SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎ノ門ダイビルイースト Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) Title: COATING PEELING DEVICE AND COATING PEELING METHOD

(54) 発明の名称: 被膜剥離装置および被膜剥離方法



(57) Abstract: Provided are a coating peeling device capable of diminishing a coating remaining on a base material film, and a coating peeling method. A coating peeling device according to the present invention peels, from a coating-equipped film that has a coating containing a water-soluble resin on at least one surface of a base material film, the coating, and comprises: a conveyance mechanism that conveys the coating-equipped film; a cleaning liquid application mechanism that applies cleaning liquid to the surface of the coating; a coating peeling mechanism that is disposed to the downstream side from the cleaning liquid application mechanism in the conveyance direction and peels, from the coating-equipped film in which the cleaning liquid has been applied to the surface of the coating, the coating containing the cleaning liquid; a cleaning liquid re-application mechanism that is disposed to the downstream side from the coating peeling mechanism in the conveyance direction and applies cleaning liquid to the surface of the coating remaining on the base material film;

[続葉有]

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

and a suction mechanism that is disposed to the downstream side from the cleaning liquid re-application mechanism in the conveyance direction and sucks up the cleaning liquid and residue of the coating remaining on the base material film.

(57) 要約: 基材フィルム上に残存する被膜を低減しうる被膜剥離装置、および被膜剥離方法を提供する。本発明の被膜剥離装置は、基材フィルムの少なくとも片面に水溶性樹脂を含む被膜を有する被膜付きフィルムから当該被膜を剥離する被膜剥離装置であって、前記被膜付きフィルムを搬送する搬送機構と、前記被膜の表面に洗浄液を付与する洗浄液付与機構と、前記洗浄液付与機構よりも搬送方向下流側に配置され、前記洗浄液が前記被膜の表面に付与された前記被膜付きフィルムから洗浄液を含んだ被膜を剥離する被膜剥離機構と、前記被膜剥離機構よりも搬送方向下流側に配置され、前記基材フィルムに残る前記被膜の表面に洗浄液を付与する洗浄液再付与機構と、前記洗浄液再付与機構よりも搬送方向下流側に配置され、前記洗浄液とともに前記基材フィルムに残る被膜の残渣を吸引する吸引機構と、を備える。